특 2002-0001035

05p-14803 0A3113110 (wo 01/97957)

# (19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.<sup>7</sup> B01D 71/06 (11) 공개번호 특2002-0001036

(43) 공개일자 2002년 이월 08일

(21) 출원번호	10-2000-0034948				
(22) 출원일자	2000년 06월 23일				
(71) 출원인	주식회사 엘지화학 노기호				
	서울특별시 영등포구 여의도동 20				
(72) 발명자	이상영				
	대전광역시유성구도룡동381-42엘지화학사택이파트5동105호				
	인병인				
	대전광역시유성구도룡동381-42엘지화학사택마파트9동301호				
	박순용				
	대전광역시유성구도룡동386-1엘지화학사택마파트3동516호				
	경유진				
	서울특별시구로구개봉3동361-5(14/2)				
	송헌식				
	대전광역사유성구도룡동381-42엘지사택9동502호				
(74) 대리인 .	송병옥				
실사용구: 있음	<u> </u>				

## (54) 다성분계 복합 분리막 및 그의 제조방법

#### 马子

본 발명은 다성분계 복합 분리막 및 그의 제조방법에 관한 것으로, 활성총과 지지총을 포함하는 복합 분리막에 있어서, 양쪽 외곽에 활성총(active layer)이 존재하고, 그 내부에는 지지총(support layer)이 존재하는 형태로 구성된 다성분계 복합 분리막을 제공한다.

본 발명에 의해 제조된 복합 분리막은 지지층 이외에 활성층에 기존의 처밀한 구조 형태는 물론 기공 조건에 따라 기공이 형성될 수 있으며 또한 그 기공 크기를 조절할 수가 있어서 기존의 복합 분리막 에 비해 현저히 개선된 투과 특성을 보이게 된다. 또한, 개선된 투과 특성 이외에 복합 분리막의 외곽 층에 존재하게 되는 활성층의 특성 발한 역시 가능하게 된다.

# AHS

<u> 5</u>1

### 412101

다성분계 복합 분리막, 지지층, 활성층, 미세 기공막, 투과도, 고결정성 폴리프로필렌, 리튬 이온 2차 전지, 전지용 격리막, 계면 접착력

# BAIH

# 도면의 간단환 설명

도 1은 실시에 1에 의해 제조된 복합 분리막의 표면에 대한 SEM 결과이며,

도 2는 비교에 1에 의해 제조된 일반적인 복합 분리막의 표면에 대한 SEM 결과이다.

# 발명의 상세로 설명

## 보명의 목적

발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 중래기술

[산업상 미용분야]

본 발명은 다성분계(multi-component) 복합 분리막(composite membrane) 및 그의 제조방법에 관한 것으로 "서, 더욱 상세하게는 지지층 이외에 활성층에 기존의 치밀한 구조 형태는 물론 가공 조건에 따라 기공이 형성될 수 있으며 또한 그 기공 크기를 조절할 수가 있어서 기존의 복합 분리막에 비해 현저히 개선된 투과 특성을 보이고, 복합 분리막의 외곽 층에 존재하게 되는 활성층의 특성 발현 역시 가능한 다성분계 복합 분리막 및 그의 제조방법에 관한 것이다.

### [종래 기술]

분리막은 다양한 분마에서 널리 미용되고 있는 것으로, 미세 여과막(microfiltration membrane), 한외 여 과막(ultrafiltration membrane), 기체 분리막(gas separation membrane), 투과 증발막(pervaporation membrane), 역삼투 막(reverse osmosis membrane) 등 여러 가지 다양한 용도로 사용될 수 있다.

이하에서는 상기 미세 여과막 중에서 전지, 특히 리튬 이온 전지에서의 격리막(separator), 특히 폴리에 틸렌 또는 폴리프로필렌을 포함하는 폴리올레핀을 주재료로 사용하는 리튬 이온 전지용 격리막을 중심으

리튬 이온 전지용 격리막의 재질로 폴리올레핀 중에서도 결정화도가 높은 고결정성 폴리프로필렌(high crystalline polypropylene: HCPP)을 사용할 경우 투과도의 큰 향상을 기대할 수 있다. 거의 모든 일반범용 폴리프로필렌의 결정화도가 50 % 미만인 것에 비해 본 발명에서 사용한 고결정성 폴리프로필렌은 결정화도가 약 50 % 이상인 것을 말하며, 일반 범용 폴리프로필렌에 비해 입체 규칙성이 높고(high isotactic), [따라서 밀도, 용용 온도, 용용열 및 결정화 온도가 높은 특성을 보이며, 고강성, 고내열성, 고충격성, 내스크레치성, 높은 치수안정성 등 여러 가지 기계적 물성들이 우수하다.

일반적인 복합 분리막의 제조방법에는 표면 중합(interfacial polymerization), 표면 개질(modification of membranes), 도포법(dip coating) 등의 방법률이 있으며, 이 중에서도 도포법이 가장 널리 사용되며, 이 로 미세 여과막 또는 한외 여과막과 같은 미세 기공막을 지지층으로 사용하고, 활성층으로 작용할 물질을 용액 상태로 도포하여 건조시켜 복합 분리막을 제조한다. 이러한 방법으로 제조된 복합 분리막은 일정 크기의 기공을 갖는 지지층 외에 기공을 거의 관찰할 수 없는 치밀한 구조의 활성층을 갖게 된다. 이경우 활성층은 미세 여과막 및 한외 여과막과 유사한 크기의 기공을 갖지 못하게 되어 그 응용에 있어서 제약을 받게 되며, 지지층과 활성층 간의 계면 접착력이 약하여 쉽게 분리(delamination)되는 단점을 지니게 되다.

상기 기공이 존재하는 미세 기공막 위에 다른 성분의 고분자 물질을 도포하여 복합 분리막을 제조하는 방법은 미국 특허 제3,249,109호, 제4,388,189호, 및 제5,102,552호 등에 잘 개시되어 있다. 또한, 분리막의 표면 개질, 특히 천수성 부여를 위한 방법으로는 미국 특허 제4,346,142호, 제5,085,775호 및 제5,294,346호에 마크릴 산(acrylic acid)과 같은 찬수성 모노마 및 폴리메틸렌 옥사이드(polyethylene oxide)와 같은 고분자들을 고로나(corona) 처리 등의 방법을 함께 미용하여 그라프트 중합(graft polymerization)시키는 방법이 개시되어 있다. 그러나, 이 경우 공정의 복잡성 및 실제 제조된 분리막의 투과 특성을 비롯한 여러 물성들이 만족스럽지 못해서 실제적으로는 거의 응용되지 못하고 있는

전지 분이에서의 응용은 일정 기공 크기를 갖는 일반 전지용 격리막 위에 고분자 전해질을 용액 상태로 고통하며 리튬 이온 2차 전지용 격리막으로 사용한 예가 미국 특허 제5,716,421호 및 유럽 특허 제 083382442호에 개시 있다. 그러나, 미러한 방법으로 분리막을 제조하게 되면 앞서 설명한 대로 분리막의 외곽에는 기공이 생성되지 않는 치밀한 구조가 되어 통기도와 같은 투과 특성이 전혀 나오지 않으며, 지 지층과 활성층 간의 계면 접착력이 약한 단점을 지나게 된다.

# 壁图的 的草亚环 矿七 기全率 亚邓

따라서 본 발명은 상기 종래 기술의 문제점을 고려하며, 지지층 이외에 활성층에 기존의 치밀한 구조 형태는 물론 가공 조건에 따라 기공이 형성될 수 있으며, 그 기공 크기를 조절할 수 있어서 기존의 분리막에 비해 현저히 개선된 투과 특성 이외에 복합 분리막의 외곽층에 존재하게 되는 활성층의 특성 발 현 역시 가능하게 되며, 또한 미온 빔 조사 공정을 추가시킬 경우 지지층과 활성층 사이의 계면 접촉력을 더욱 향상시킬 수 있는 복합 분리막 및 그의 제조방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.

# 발명의 구성 및 작용

[과제를 해결하기 위한 수단]

본 발명은 상기 목적을 달성하기 위하여, 활성총과 지지층을 포함하는 복합 분리막에 있어서, 양쪽 외곽 에 활성층(active layer)이 존재하고, 그 내부에는 지지층(support layer)이 존재하는 형태로 구성된 다 성분계 복합 분리막을 제공한다.

또한, 본 발명은 다성분계 복합 분리막의 제조 공청에 있어서, 상기 다성분계 복합 분리막의 제조 공청이

- a) 지지층으로 사용될 고분자를 압출기에 투입하여 원판 필름을
  - 제조하는 단계;
- b) 상기 제조된 원판 필흡을 고분자 용용점 이하의 온도에서 어닐링

시키는 단계:

- c) 상기 어틸링시킨 원판 필름 한면 또는 양면에 반응성 가스 도움에
  - 의한 미온 밤을 조시하는 단계;
- d) 상기 이온 밤이 조시된 원판 필름 양면에 활성층으로 사용될 고분자 용액을 도포시키는 단계;

- e) 상기 원판 필름 양면에 도포된 고분자 용액을 건조시키는 단계;
- f) 상기 고분자 용액이 건조된 원판 필름을 상온 이하의 온도에서 저온 면신시키는 단계;
- g) 상기 저온 연신된 필름을 고분자 용용점 이하의 온도에서 고온 연신시키는 단계; 및
- h) 상기 고온 연신된 필름을 고분자 용용점 이하의 온도에서 장력이 부여된 상태로 열 고정시키는 단계
- 를 포함하는 다성분계 복합 분리막의 제조방법을 제공한다.

미하에서 본 발명을 상세하게 설명한다.

본 발명에서는 이와 같은 일정 크기의 기공을 갖는 미세 기공막 위에 활성 물질을 도포하여 제조하는 일 반적인 복합 분리막 및 그의 제조방법과는 달리 기공을 전혀 갖지 않는 일반 필름 위에 활성 물질을 도포 한 후 복합 분리막을 제조하는 새로운 개념의 복합 분리막 및 그의 제조방법을 제시하고자 한다.

본 발명에서는 연신을 미용하여 기공을 형성하는 일반적인 건식법(dry process)과 용매를 사용하는 상전 이법(phase inversion)을 적절히 함께 사용하여 복합 분리막을 제조한다. 또한, 이온 빔 조사 공정을 추 가시킬 경우 지지층과 계면층 사이의 계면 접착력을 더욱 향상시킬 수 있다.

일반적인 건식법은 고분자 결정 부분을 일정 방향으로 배향 (orientation)시킨 후 냉연신을 통해 상대적 으로 약한 무정형 부분을 파열시켜 기공을 형성하는 방법으로, 결정 부분의 균일한 배향 및 정도에 따라 제조된 부리막의 특성이 결정된다.

한편, 상전이법은 고분자 용액을 만든 후, 온도 또는 비용매 (nonsolvent)등을 적절히 사용하여 고분자와 용매와의 상분리를 일으켜 기공을 형성하는 방법으로 상분리 조건에 따라 제조된 분리막의 특성이 결정된 다.

다.

미온 빔 조사 공정은 일종의 표면 개질 방법으로 진공 중에서 아르곤, 수소, 산소, 질소, 이산화탄소와 같은 기체들을 미온화하여 고분자 표면에 충돌시켜 표면을 활성화시킨 후, 또 다른 반응성 기체들을 그표면 위에 출려보내 고분자 표면과 반응을 일으켜 표면을 개질시키는 방법이다. 본 발명에서는 지지 총으로 작용할 물질을 건식법 공정 중의 한 단계인 원판 필름(precursor (ilm) 제조 공정으로 제조한 후, 활성총으로 작용할 고분자 용액을 그 원판필름 위에 도포한 후, 적절한 조건 하에서 상분리 시킨 후, 다시 건식법 공정인 연산법을 미용하여 기공을 형성한다. 이때, 지지층과 활성층 사이의 계면 접착력을 보다 더 높이기 위하여 활성층으로 작용할 고분자 용액을 도표하기 전에 원판 필름에 이온 빔 조사를 하여 표면 개질을 먼저 시행 활수 있다. 본 발명으로 제조된 복합 분리막의 경우, 지지층으로 작용할 물질및 활성층으로 작용할 물질 모두 기공을 형성하게 된다. 이때, 지지층 및 활성층 각각의 기공 크기 및 분포는 서로 성이한 데, 이것은 지지층은 앞서 살행된 원판 팔름 공정에 의해 결정 구조가 일정 방향으로 배향된 후 연산법에 의해 기공이 형성된 반면, 활성층은 상분리에 의해 고분자 박막이 형성된 후, 연산법에 의해 기공이 형성되는 제조 공정상 차이에 기인하기 때문이다. 이때, 상분리에 의해 형성된 고분자 박막으 상분리 조건에 따라 처랄한 구조, 미세 고열 혹은 미세 기공이 연산 전에 이미 형성될 수 있으며, 또한 그 기공 형성 정도가 조절될 수 있다.

본 발명에 의해 제조된 복합 분리막의 지지총은 일반적인 건식법 공청을 이용하여 제조된 분리막과 동일한 물성을 지니며, 활성총은 그 공정 조건에 따라 다양하게 변화된 크기의 기공을 갖게 된다. 또한, 연선법 공정 중 고온을 사용하는 고온 연선 및 열 고정 단계를 거치게 되는 데, 이러한 고온에서의 공청들병해 지지총과 활성총 사이의 고본자 사슬의 상호 결합(inter-diffusion)에 중대되어 지지총과 활성총 사이의 계면 접착력이 증가되게 된다. 이러한 계면 접착력은 이온 밤 조사 공정을 거치게 될 경우 더욱 향상될 수 있다.

양월 수 있다.

본 발명의 지지층으로 사용될 물질로는 크게 제약이 없으나, 일반적으로 고말도쫄리에틸렌(high density polyethylene), 저말도쫄리에틸렌(low density polyethylene), 선형저밀도쫄리에틸렌(linear low density polyethylene), 전형저밀도쫄리에틸렌(linear low density polyethylene), 폴리프로필렌(high crystalline polypropylene), 폴리에밀린-로필렌 공중합체(polyethylene-propylene), 폴리에틸렌-부틸렌 공중합체(polyethylene-butylene copolymer), 폴리에틸렌-헥센 공중합체(polyethylene-hexene copolymer), 폴리에틸렌-엑센 공중합체(polyethylene-hexene copolymer), 폴리에틸렌-엑센 공중합체(polyethylene-hexene copolymer), 폴리에틸렌-목힌 공중합체(polyethylene-butylene-styrene copolymer), 폴리스티렌-에틸렌-부틸렌-스티렌 공중합체(polyetyrene-ethylene-butylene-styrene copolymer), 폴리스티렌-에틸렌-부틸렌-스티렌 공중합체(polyetyrene-ethylene-butylene-styrene copolymer), 폴리스티렌 (polyetyrene), 폴리페닐렌 옥사이드(polyetyrene-ethylene-butylene-styrene copolymer), 폴리스티렌 (polyetyrene), 폴리메닐렌 옥사이드(polyetyrene), 폴리어미드(polysulfone), 폴리카보네이트(polystyrene), 폴리메닐렌 옥사이드(polyetyrene), 폴리버틸리덴 클루오라이드(polywinylidene chloride), 폴리스티렉트(polyolelin) 이어오노대(lonomer), 폴리메틸펜덴(polymethyl pentene), 하이드로제네이티드 올리의시아이들리아이트(polyethyl pentene), 하이드로제네이티드 올리리사이클로펜타디앤(hydrosenated olisocyclopentadlene: HOCP), 및 이들의 혼합물로이루어지는 군으로부터 선택되는 1 중 이상의 물질이 단독, 블랜드, 또는 적층(lamination) 형태로 사용되는 것이 바람직하다.

한편, 활성증으로 사용되는 고분자 용액 중의 고분자 물질은 복합 분리막의 최종 목적에 따라 선택되어지는데, 그 예로는 즐리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리비닐리덴 플루오라이드(polyviny) idene fluoride), 폴리비닐리덴 플루오라이드 행사들루오로프로필렌 공중합체(polyviny) iden fluoride hexaf luoropropy lene copolymer), 폴리에틸렌 옥사이드(polyethylene oxide), 폴리프로필렌 옥사이드(polypropylene oxide), 폴리푸틸렌 옥사이드(polybutylene oxide), 폴리우레탄(polyurethane), 폴리아크 릴로니트릴(polyacrylonitrile), 폴리아크릴레이트(polyacrylate), 폴리아크릴십(polyacrylic acid), 폴

리아미드(polyamide), 폴리아크릴아미드(polyacrylamide), 폴리버닐아세테이트(polyvinylacetate), 폴리 · 비닐피롤리돈(polyvinylpyrrolidone), 폴리테트라에틸렌 글리클 디아클릴레이트(polytetraethylene glycol diacrylate), 폴리술폰(polysulfone), 폴리페닐렌옥사이드(polyphenylene oxide), 폴리카보네이트 (polycarbonate), 폴리에스탠르(polyester), 폴리베닐리덴클루오라이드(polyvinylidene chioride), 폴리 실록산(polysiloxane), 폴리올레핀(polyolefin) 아이오노메(ionomer) 및 미들의 유도체로 미루어지는 군 으로부터 선택되는 1 중 이상의 물질이 비란직하다.

활성층으로 사용되는 고분자 용액 중의 물질에 대한 용매로는 사용되는 고분자들에 따라 각각 다르지만, 일반적으로 1-메틸-2-피롤리돈(1-methyl-2pyrrolidone: NMP), 아세톤(acetone), 에단을 (ethanol), 亦프로판을(n -propanol), 亦부탄율(n -butanol), 亦핵산(n -hexane), 사이클로핵산을 (cyclohexanol), 마세틱 산(acet ic acid), 에틸마세테이트(ethyl acetate), 디에틸에테르(diethyl ether), 디메틸포롬이메드(dimethyl formamide: DMF), 디메틸이베드(DIM트이메드(dimethylacetamide: DMAC), 다이옥산(dioxane), 테트리하이드로퓨란(tetrahydrofuran: THF), 디메틸솔폭사이드(dimethyl sulfoxide: DMSO), 시클로핵산(cyclohexane), 벤젠(benzene), 통루엔(toluene), 크실렌(xylene), 물(water) 및 이들의 혼합물로 이루어지는 군으로부터 기종 이상 선택되는 것이 바람작하다.

활성총으로 존재할 고분자 용액의 도포 및 건조 조건은 다음과 같다. 즉, 고분자 용액의 도포를 증래의 분리막이 아닌 기공이 관찰되지 않은 일반 필름 표면 위에 딥 코팅(dip-coating) 방식으로 도포하며, 이때, 고분자 용액은 농도가 0.01 중량값 이상인 것이 바람직하다. 또한, 필름에 도포된 고분자 용액의 건조가 상대습도 1 내지 100 %에서 이루머지는 것이 바람직하며, 용매들의 포화 증기압 이하에서 질소, 산소, 이산화탄소, 공기 등을 포함하는 가스를 중에서 선택된 가스로 둘러싸인 분위기 하에서 건조하는 것이 바람직하다. 이때, 고분자 용액의 도포 및 건조 후 두께가 0.1 내지 20 ㎞인 활성층을 형성하는 것이 바람직하다.

이온 범 조사 조건은 10<sup>-1</sup> 내지 10<sup>-6</sup> torr 정도의 진공을 사용하며, 전자, 수소, 헬륨, 산소, 질소, 이산화탄소, 공기, 불소, 네온, 아르곤, 크립톤, NO 및 이들의 혼합물들을 여기시켜 0.01 내지 10<sup>-6</sup> keV 정도의 에너지를 갖게 한 후 원판 필름 표면에 조사시킨다. 이때, 이온 입자의 조사량은 10<sup>-6</sup> 내지 10<sup>-70</sup> iors/cm<sup>-7</sup>가 바람직하다. 또한, 반응성 기체로는 헬륨, 수소, 산소, 질소, 암모니아, 일산화 탄소, 이산화 탄소, 사불화 탄소, 메탄, NO 및 이들의 혼합물들을 포함하는 것이 바람직하며, 주입량은 약 0.5 내지 20 m2/분 정도가 바람직하다.

본 발명의 다성분계 복합 분리막의 제조방법은 다음의 단계를 포함한다.

- a) 지지층 원판 필름의 제조 : 지지층으로 사용될 고분자를 T-CIOI(T-die) 또는 원형 관 CIOI (tubular die)가 부착된 압출기(extruder)로 압출하여 원판 필름을 제조한다.
- b) 머닐링(annealing) : 상기 제조된 원판 필름의 결정화도 및 탄성 복원율률 높이기 위하여 건 조 오븐메서 고분자 용용점 이하의 온도에서 머닐링시킨다.
- c) 반응성 가스 도움에 의한 미온 빔 조사 : 고진공으로 유지된 진공조 내에 원판 필름을 투입한 후, 미온 총(gun)에 미온 생성 가스를 주입하며 에너지를 가진 입자를 생성시킨 후 미온 빔 전류를 변화시키면서 에너지를 가진 입자를 원판 필름 표면의 한쪽 면 또는 양쪽 면 모두에 조시한다. 미때, 미온 총에 면결된 전원 장치를 조절하여 에너지를 가진 입자의 에너지가 0.01 내지 10 keV가 되게 한다. 미온 빔 조사와 동시에 원판 필름 주위에 반응성 가스 주입량을 0.5 내지 20 mV분으로 변화시키면서 반응성가스 주입기에 의해 반응성 가스를 주입하여 표면 개질을 시킨다. 이러한 표면 개질 단계는 어닐링 전혹은 후 모두 적용될 수 있으며, 최종 복합 분리막 물성에 따라 시행 여부를 판단한다.
- d) 활성층 고분자 용액의 도포 : 활성층으로 사용될 고본자를 적당한 용매를 사용하며 용액 상태로 제조한 후, 앞서 제조한 원판 필름 위에 도포한다. 도포될 원판 필름은 어닐링 전 혹은 후 모두 적용될 수 있다. 또한, 최종 복합 분리막 물성에 따라 도포 공정에 앞서 반응성 가스 도움에 의한 미온 박조사 공정을 선행할 수 있다. 고분자 용액의 농도 및 도포 조건은 사용 물질 및 최종 용도에 따라 다양하게 변화될 수 있다.
- e) 상전미법에 의한 활성층 고분자 박막의 형성 : 원판필름 위에 도포가 끝난 후, 적절한 건조 조건에서 용매를 증발시킨다. 미때, 건조 조건에 따라 활성층 고분자 박막의 구조가 결정된다.
- f) 저온 연신 : 머닐링한 필름을 롤(roll) 또는 기타 다른 연신기를 이용하여 상은 이하의 온도 에서 1 축으로 연신시켜 미세 균열을 생성시킨다.
- 9) 고온 연신 : 물(roll) 또는 기타 다른 연신기를 이용하며 지지층 및 활성층 고분자의 용용점 이하의 온도에서 앞서 이온 템 조사 및 저온 연신 등에 의해 제조된 미세 균열을 1 축 또는 2 축 연신시 켜 원하는 크기를 지난 미세 기공을 형성하며, 또한 이러한 고온 연신을 통해 막의 기계적 물성을 부여한 다.
- h) 열 고정 : 상기 고온 연신이 끝난 후, 지지총 및 활성총 고분자의 용용점 미하의 온도에서 장력을 받은 상태 그대로 일정 시간 열 고정시킨다.
- 상기 단계들은 최적의 물성을 갖는 복합 분리막의 제조 공정에 대하여 설명한 것이며, 원하는 최 중 물성에 따라서 일부 단계를 생략하거나 추가 공정을 부가할 수 있으며, 각 단계를 중의 일부는 순서도 변경될 수 있다.

'미하의 실시에 및 비교예를 통하며 본 발명을 더욱 상세하게 설명한다. 단, 하기 실시에는 본 발명을 예 시하기 위한 것으로서 본 발명이 하기 실시에에 의하여 한정되는 것은 아니다.

이하의 실시에 및 비교예를 통하며 제조되는 미세 기공막을 하기 항목에 따라서 평가하였다.

- a) 두메; 🤏
- b) 통기도 (air permeability): JIS P8117;
- .c) 기공 크기 (pore size): SEM, TEM;
- d) 계면 접착력: JIS Z 0237; 및
- e) 전해액 합침속도: 사용 전해액

(에틸렌 카보네이트 : CI메틸 카보네이트 = EC : DMC = 4 : 6)

[실시예1]: 고결정성 폴리프로필렌/카미나461(Kynar461) 복합 분리막

지지층으로는 고결정성 폴리프로필렌을, 활성층으로는 폴리비닐리덴플루오라이드(PYOF)를 사용하여 원판 필름을 제조하고, 이 원판 필름을 건식법으로 연신하여 복합 분리막을 제조하였다.

#### (원판 필름 제조]

지지층 성분으로 용용 지수(melt index) 0.50 g/10 분, 밀도 0.91 g/cc, DSC로 측정된 용용 온도 166.5 ℃, 결정화 온도 134.5 ℃, 결정화또 57 %, C<sup>11</sup> NMR로 측정된 아이소틱티시티 98 %, 크실렌으로 녹인 후 측정된 아틱틱 분율 약 2 %인 고결정성 폴리프로필렌를 사용하였으며, 고결정성 폴리프로필렌 원판 필름(precursor film)은 T-디이가 부착된 일축 압출기(single screw extruder) 및 권취 장치(take-up device)를 미용하며 제조하였다. 이때의 압출 온도는 220 ℃, 권취 장치의 냉각 롤(roll) 온도는 80 ℃, 권취 속도는 20 m/분이었으며, 권취비는 60이었다.

#### (어닐링)

상기에서 제조된 원판 필름을 건조 오븐에서 150 tc의 온도로 1 시간 동안 머닐링하였다.

#### (도포)

어닐링 후, 아세톤을 용매로 하여 낮은 결정화도를 갖는 미국 엘프 아토캠 노스아메리카(Elf Atochem North America)사의 카이니셔61(Kynar461)을 녹인 용액을 어닐링이 끝난 지지총 원판 필름 위에 일반적인 딥 코팅(Dip Coating) 방식으로 양면에 도포시켰다. 이때 도포는 대기중에서 약 60 % 정도의 상대 습도를 유지하는 조건에서 행하였으며 동일한 습도 조건에서 마세톤을 증발시켰다. 도포된 카이나 461(Kynar461) 두께는 약 3 km 정도였다.

#### (저온 면신)

도포가 끝난 후, 필름을 상온에서 초기 길이에 대하며 50 %의 연신 배율로 1 축 연신시켰다.

# (고온 연신)

·저온 연신 후, 필름을 140 'C의 온도에서 100 %의 연신 배율로 고온 1 축 연신시켰다.

#### (열 고정)

고온 연신 후, 140 ·c의 온도에서 장력을 받은 상태로 10 분간 열 고정을 시킨 후 냉각하며 복합 분리막을 제조하였다.

제조된 복합 분리막의 여러 가지 물성들을 하기 표 1에 나타내었다.

하기 표 1을 살펴보면, 비교예와 같은 일반적인 방식인 분리막 위에 카이니461(Kynar461)을 도포한 경우, 활성층인 카이니461(Kynar461)에는 미세 기공이 관찰되지 않는 반면, 실시예 1의 경우 지지층이외에 활성층 역시 미세 기공이 형성되었음을 볼 수 있었으며(도 1 및 도 2 참조), 이로 인해 통기도가현저히 개선되었음을 알 수 있다. 또한, 지지층과 활성층 사이의 계면 접착력이 개선되었음을 알 수 있다. 이와 같은 물폴로지(morphology) 변화 및 계면 접착력 향상 때문으로 추정되는 이유에 의해 전해액합침속도 역시 매우 빨리졌음을 알 수 있다.

[ 실시예 2]: 이온 빔 조사 공정을 포함한 고결정성 폴리프로필렌/카이LH461(Kynar461) 복합 분리 막

카이나461(Kynar461) 용액을 도포하기 전 원판 필름에 이온 밤을 조사한 것을 제외하고는 상기 실시에 1과 동일한 방법으로 복합 분리막을 제조하였다. 상기 실시에 1과 동일한 방법으로 제조된 원판 필름을 10° 내지 10° torr로 유지시킨 진공조에 투입한 후, 아르곤 입자(Ar')를 이온 총(lon sun)을 이용 하여 원판 필름의 양면에 조사하면서 동시에 필름 주위에 반응성 가스(산소)의 주입량을 4 m²/분으로 하여 반응성 가스 주입기에 의해 주입하여 표면 처리를 하였다. 이때, 이온 밤의 에너지는 0.5 keV, 이온 조사량은 10° lons/cm²이었다. 이온 밤 조사 공정이 끝난 후, 상기 실시에 1과 동일한 방법으로 복합 분 리막을 제조하였다. 제조된 복합 분리막의 여러 가지 물성들을 하기 표 1에 나타내었다.

하기 표 1을 살펴보면, 이온 밤 조사 공정이 포함되지 않은 실시에 1과 마찬가지로 지지용 및 활성용 모두 기공이 형성되었음을 관활할 수 있으며, 특히 지지총과 활성총 사이의 계면 접착력이 크게 개선되고, 전해액 합침속도 역시 크게 개선되었음을 알 수 있다.

# [실시예3]: 고밀도 폴리에틸렌/카이LH461(Kynar461) 복합막

지지층으로 고결정성 플리프로필렌 대신 고밀도 폴리에틸렌을 사용한 것을 제외하고는 상기 실시 예 1과 동일한 방법으로 복합 분리막을 제조하였다. 사용된 고밀도 폴리에틸렌은 용용 지수 0.3 9/10 분, 밀도 0.954 9/cc이었다. 원판 필름은 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 제조하였다. 이때의 압출 온도는 200 ℃, 권취 장치의 냉각/를(roll) 온도는 80 ℃, 권취 속도는 30 m/분, 권취비는 80이었다. 제 조된 원판 필름을 건조 오븐에서 125 ℃에서 1 시간 동안 머닐링시켰다. 머닐링 후 실시에 1과 동일한 \* 방법으로 카이니셔61(Kynar461) 용액을 원판 필름 위에 양면에 도포시켰다. 도포가 끝난 후, 상온에서 초 기 길이에 대해 50 %의 연신 배율로 1 축 면신시켰으며, 이 후 계속해서 120 ℃에서 50 %의 연신 배율로 고온 1 축 면신시켰다. 고온 연신 후 120 ℃에서 장력을 받은 상태로 10 분간 열 고정을 시킨 후 냉각하 며 복합 분리막을 제조하였다. 제조된 복합 분리막의 여러 가지 율성들을 하기 표 1에 나타내었다.

하기 표 1을 살펴보면, 실시에 1과 유시하게 지지층 및 활성층 모두 기공이 형성되었음을 알 수 있으며, 지지총과 활성층 사이의 계면 접착력 및 전해액 합침속도 역시 개선되었음을 알 수 있다.

[비교예 1]: 셀가드2400(Celgard2400)/카이나461(Kymar461)로 구성된 복합 분리막

상기 실시예 1, 2, 및 3과는 달리 일반적인 방법인 미세 기공막 위에 활성총을 도포하였다.

지지층인 미세 기공막으로는 폴리프로필렌 단독으로 제조된 제품인 미국 셀라니즈(Celanese)사의 셀가드2400(Celgard2400)을 사용하였으며, 활성층은 상기 실시예 1, 2, 및 3과 동일하게 카미나 461(Kynar461)을 사용하여 카미나461(Kynar461) 용액을 제조한 후, 기공을 갖고 있는 셀가드 2400(Celgard2400) 위에 카미나461(Kynar461) 용액을 도포하여 복합 분리막을 제조하였다.

도 1 및 도 2를 참조하면, 비교예 1에서 제조된 복합 분리막은 활성층에 기공이 전혀 없는 반면, 본 발명의 방법(실시예 1)에 따라 제조된 복합 분리막은 활성층에 기공이 형성되어 있음을 알 수 있다.

제조된 복합 분리막의 여러 가지 물성들을 하기 표 1에 나타내었다.하기 표 1을 살펴보면, 셀가드2400(Celgard2400)/카이나461(Kynar461)로 구성된 복합 분리막의 통기도는 상기 실시예 1, 2, 및 3과는 달리 거의 측정을 할 수 없을 정도로 매우 불량한 투과도를 보였으며, 계면 접착력 및 전해액 함침속도 모두 상대적으로 열등한 것을 알 수 있다.

			7-m //		
구분		실시예 1	실시예 2	실시예 3	비교예 1
두개 (xm)		20	20	20	20
공경 (#m)	지지층	$0.3 \times 0.1$	$0.3 \times 0.1$	$0.4 \times 0.1$	$0.3 \times 0.1$
	활성층	$0.8 \times 0.3$	$0.8 \times 0.3$	0.6 x 0.3	관측 불가
통기도 (sec/100cc)		560.	565	620	측정 불가
계면 접착력 (91)		180	250	240	85
전해액힘침속도(sec)		10	8	9	45

[# 1]

# 警告司 夏季

기존의 일반적인 방법으로 제조된 복합 분리막의 경우 통기도가 거의 측정될 수 없을 정도의 불량한 투과 특성을 보이는 반면, 본 발명에 의해 제조된 복합 분리막은 통기도가 560 내지 620 sec/ 100cc를 나타냄 으로써, 지지층 미외에 활성층에 기존의 처밀한 구조 형태는 물론 가공 조건에 따라 기공이 형성될 수 있 으며 또한 그 기공 크기를 조절할 수가 있어서 기존의 복합 분리막에 비해서 현저히 개선된 투과 특성을 보이게 된다. 또한, 개선된 투과 특성 미외에 복합 분리막의 외곽 층에 존재하게 되는 활성층의 특성 발 현 역시 가능하게 된다. 즉, 본 발명에 의해 제조된 복합 분리막의 지지층은 일반적인 건석법 공정을 이 용하여 제조된 분리막과 동일한 물성을 지니며, 활성층은 그 공정 조건에 따라 다양하게 변화된 크기의 기공을 갖게 된다.

또한, 기존의 일반적인 방법으로 제조된 복합 분리막의 경우 85 9,의 계면 접착력을 나타내는 반면에, 본 발명에 의해 제조된 복합 분리막의 경우 160 내지 250 9,의 계면 접착력을 나타내게 된다. 즉, 연신법 공 정 중 고온을 사용하는 고온 연신 및 열 고정 단계를 거치게 되는 데, 이러한 고본에서의 공정을 통해 지 지층과 활성층 사이의 고분자 사슬의 상호 결합이 증대되어 지지층과 활성층 사이의 계면 접착력이 증가 되게 된다. 이러한 계면 접착력은 이온 빔 조사 공정을 거치게 될 경우 더욱 향상될 수 있다.

또한, 이러한 복합 분리막의 볼폴로지(morphology) 및 계면 접착력 향상 등으로 추정되는 원인에 의해 전해액 합침속도 역시 크게 개선될 수 있다.

# (57) 君子의 범위

# 청구한 1

활성층과, 지지층을 포함하는 복합 분리막에 있어서, 양쪽 외곽에 활성층(active layer)이 존재하고, 그 내부에는 지지층(support layer)이 존재하는 형태로 구성된 다성분계 복합 분리막.

## 청구항 2

# 제 1 항에 있어서,

상기 지지총의 성분이 고밀도폴리에틸렌(high density polyethylene), 저밀도폴리에틸렌(low density polyethylene), 선행저밀도폴리에틸렌(linear low density polyethylene), 폴리프로필렌(polypropylene), 고결정성 폴리프로필렌(high crystalline polypropylene), 폴리에틸렌-프로필렌 공중합체(polyethylene-propylene copolymer), 폴리에틸렌-부틸렌 공중합체(polyethylene-butylene copolymer),

풀리에틸렌•헥센 공중합체(polyethylene-hexene copolymer), 폴리에틸렌-옥텐 공중합체(polyethylene-octene copolymer), 폴리스티렌-부틸렌-스티렌 공중합체(polystyrene-butylene-styrene copolymer), 폴리스티렌-부틸렌-스티렌 공중합체(polystyrene-ethylene-butylene-styrene copolymer), 폴리스티렌 (polyetyrene), 폴리스티렌 (polyetyrene), 폴리메닐렌옥사이드(polyphenylene oxide), 폴리슬폰(polysulfone), 폴리카보네이트(polycarbonate), 폴리메닐렌옥사이드(polyetter), 폴리이테드(polyamide), 폴리메르덴(polyurethane), 폴리아 크릴레이트(polyacrylate), 폴리베닐리덴클루오라이드(polyvinylidene chloride), 폴리베닐리덴플루오라이드(polyvinylidene chloride), 폴리베틸리덴플루오라이드(polyvinylidene fluoride), 폴리베틸렌덴(polymethyl pentene), 하이드로제네이티드 올리고사이클로펜타디엔(hydrogenated oligocyclopentadiene: HOCP), 및 이들의 유도체로 이루어진 군으로부터 선택된 1 중 이상의 고분자들인 다성분계 복합 분리막.

#### 청구항 3

제 2 항에 있어서,

상기 고결정성 졸리프로필렌은 밀도가 0,905 g/cc 이상이며, 용용 온도 164 ℃ 이상, 결정화 온도 125 ℃ 이상, 결정화도 50.% 이상, 아이소락티시티 96.% 이상, 및 아락틱 분율 5.% 미만으로 이루어진물성 군에서 선택된 1 중 이상의 물성을 만족하는 고결정성 폴리프로필렌인 다성분계 복합 분리막.

### 청구항 4

제 1 항에 있머서,

상기 지지층의 기공 크기가 0.001 내지 10 째인 다성분계 복합 분리막.

## 청구항 5

제 1 항에 있어서,

상기 지지층의 두께가 1 내지 50 xm인 다성분계 복합 분리막.

## 첨구항 6

제 1 항에 있머서,

상기 활성총의 성분이 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리비틸리덴 플루오라이드(polyvinylidene fluoride), 폴리비틸리덴 플루오라이드 헥사플루오로프로필렌 공중합체(polyvinylidene fluoride), 폴리비틸리덴 플루오라이드 헥사플루오로프로필렌 공중합체(polyvinylide fluoride-hexafluoropropylene copolymer), 폴리에틸렌 옥사이드(polybutylene oxide), 폴리우리탄(polyurethane), 폴리아크 릴로니트릴(polyacrylinitrile), 폴리아크릴레이트(polyacrylate), 폴리아크릴산(polyacrylic acid), 폴리아크릴산(polyacrylic acid), 폴리아크릴산(polyacrylic acid), 폴리아리트(polyamide), 폴리아크릴라이트(polyacrylic acid), 폴리아리트(polyamide), 폴리아크릴라이트(polyacrylic acid), 폴리아리트(polyamide), 폴리아크릴라이트(polyacrylic acid), 폴리아리트(polyamide), 폴리아크릴라이트(polyacrylic acid), 폴리 베닐피롱리돈(polyamide), 폴리아리트(polyacrylic acid)를리 드라프릴레이트(polytetraethylene slycol diacrylate), 폴리슬폰(polyaulfone), 폴리메닐렌옥사이드(polyphanylene oxide), 폴리카보네이트(polyacryloneth), 폴리에스테르(polyester), 폴리메닐렌옥사이드(polyphanylene oxide), 폴리카보네이트(polycarbonate), 폴리에스테르(polyester), 폴리메닐리덴클루오라이드(polywinylidene chloride), 폴리 실록산(polysiloxane), 폴리올레핀(polyoletin) 아이오노머(lonomer), 및 이들의 유도체로 이루어진 군으로부터 선택된 1층 이상의 고분자들인 다성분계 복합 분리막

# 청구한 7

제 6 항에 있머서,

상기 활성층의 성분에 대한 용매가 1-메틸-2-피롤리돈(1-methyl-2pyrrolidore: MMP), 이세톤 (acetone), 에탄울(ethanol), ㅠ프로판울(ㅠ-propanol), ㅠ부틴율(ㅠ-butanol), ㅠ렉산(ㅠ-hexane), 사이클로엔산울(cyclohexanol), 마세틱 산(acetic acid), 에틸마세테이트(ethyl acetate), 디메틸에테르(diethyl ether), 디메틸포롬마미드(dimethyl formamide: DMF), 디메틸아세트마미드(dimethylacetamide: DMAC), 디메옥산(dioxane), 테트리하미드로퓨란(tetrahydrofuran: THF), 디메틸울족사미드(dimethylsulfoxide: DMSO), 사미클로헥산(cyclohexane), 벤젠(benzene), 톨루엔(toluene), 크실렌(xylene), 물 (water), 및 미들의 혼합물로 미루어진 군으로부터 선택된 1 중 미상의 용매들인 다성분계 복합 분리막.

# 청구항 8

제 1 항에 있머서,

상기 활성총의 기공 크기가 10 🖛 이하인 다성분계 복합 분리막.

### 청구항 9

제 1 형에 있어서,

상기 활성층의 두께가 0:01 내지 20 째인 다성분계 복합 분리막,

### 청구한 10

제 1 항에 있머서,

상기 복합 분리막의 통기도가 7,000 초/100 cc 이하인 다성분계 복합 분리막,

# 청구항 11

제 1 함에 있어서,

상기 복합 분리막의 전해액(에틸렌 카보네이트/디메틸 카보네이트 = 4/6)에 대한 함침속도가 30<sup>\*</sup> 초 이하인 다성분계 복합 분리막.

#### 청구항 12

제 1 항에 있어서,

상기 활성층은 2 층 미상, 상기 지지층은 1 층 미상 존재 하에 전체적으로 적어도 3 층 미상의 다층 구조를 갖는 다성분계 복합 분리막.

## 청구항 13

제 1 항에 있머서,

상기 지지총이 상기 제 2 항의 고분자 성분들의 블렌드나 적총(laminate) 형태로 구성되는 다성 분계 복합 분리막.

## 청구항 14

제 1 항에 있어서,

상기 다성분계 복합 분리막이 수처리막, 혈액 투석막, 효소 정제막, 약 전달 패취(patches for drug delivery), 기체 분리막, 투과 증발막, 역삼투막, 및 전기 분해막으로 미루어지는 군으로부터 선택되는 용도로 사용되는 다성분계 복합 분리막.

#### 청구한 15

상기 제 1 항 기재의 다성분계 복합 분리막을 포함하는 전치 격리막.

#### 청구항 16

상기 제 1 항 기재의 다성분계 복합 분리막을 격리막으로 사용하는 리튬 이온 2차 전지 또는 리튬 이온 폴리머 2차 전지.

#### 청구항 17

다성분계 복합 분리막의 제조 공정에 있어서, 상기 다성분계 복합 분리막의 제조 공정이

- a) 지지층으로 사용될 고분자를 압출기에 투입하여 원판 필름을
  - 제조하는 단계;
- b) 상기 제조된 원판 필름을 고분자 용용점 이하의 온도에서 어닐링 시키는 단계:
- c) 상기 어닐링시킨 원판 필름 한면 또는 양면에 반응성 가스 도움에 의한 미온 밤을 조사하는 단계;
- d) 상기 이혼 밤이 조시된 원판 필름 양면에 활성층으로 사용될 고분자 용액을 도포시키는 단계;
- e) 상기 원판 필름 양면에 도포된 고분자 용액을 건조시키는 단계;
- f) 상기 고부자 용액이 건조된 원판 필름을 상은 이하의 온도에서 저온 연신자키는 단계;
- 9) 상기 저온 연신된 필름을 고분자 용용점 이하의 온도에서 고온 연신시키는 단계: 및
- h) 상기 고온 연신된 필름을 고분자 용용점 이하의 온도에서 장력이 부여된 상태로 열 고청시키는 단계
- 를 포합하는 다성분계 복합 분리막의 제조방법,

# 청구항 18

제 17 항에 있어서,

상기 d) 단계의 고분자 용액이 딥 코팅(Dip-coating) 방식으로 원판 필름 양면에 도포되는 다성 분계 복합 분리막의 제조방법.

## 청구항 19

제 17 형에 있어서.

상기 d) 단계의 고분자 용액의 농도가 0.0 중량% 이상인 다성분계 복합 분리막의 제조방법.

# 청구항 20

제 17 항에 있머서,

상기 e) 단계의 원판 필름 양면에 도포된 고분자 용액의 건조가 상대습도 1 내지 100 X에서 이루 어지는 다성분계 복합 분리막의 제조방법.

### 청구항 21

제 17 형에 있어서,

상기 e) 단계의 원판 필름 양면에 도포된 고분자 용액의 건조가 용매물의 포화 증기압 이하에서 이루어지는 다성분계 복합 분리막의 제조방법.

### 청구항 22

제 17 항에 있어서,

상기 e) 단계의 원판 필름 양면에 도포된 고분자 용액의 건조가 질소, 산소, 이산화탄소, 및 공기로 이루어진 군으로부터 선택되는 가스로 둘러싸인 분위기 하에서 이루어지는 다성분계 복합 분리막의 제조방법.

## 청구항 23

제 17 항에 있어서,

상기 d) 및 e) 단계의 고분자 용액의 도포 및 건조를 통하며 두께 0.1 내지 20 #m의 활성총이 형성되는 다성분계 복합 분리막의 제조방법.

## 청구항 24

제 17 항에 있어서,

상기 c) 단계의 반응성 가스 도움에 의한 이온 빔 조사가 10<sup>-1</sup> 내지 10<sup>-6</sup> torr의 진공 조건하에서 이루어지는 다성분계 복합 분리막의 제조방법.

## 청구항 25

제 17 항에 있어서,

상기 c) 단계의 반응성 가스 도움에 의한 이온 밤 조사가 전자, 수소, 헬륨, 산소, 질소, 이산화탄소, 공기, 불소, 네온, 아르곤, 크립톤, NO 및 이들의 혼합물로 이루어진 군으로부터 선택된 가스를 여기시켜 0.01 내지 10<sup>6</sup> keV의 에너지를 갖게 한 후 원판 필름 표면에 이루어지는 다성분계 복합 분리막의 제조방법,

# 청구항 26

제 17 항에 있어서,

상기 c) 단계의 반응성 가스 도움에 의한 이온 밤 조사가 이온 입자의 조사량 10 <sup>5</sup> 내지 10 <sup>30</sup> lons/cm의 범위에서 이루어지는 다성분계 복합 분리막의 제조방법.

# 청구항 27

제 17 항에 있어서,

상기 6) 단계의 반응성 가스 도움에 의한 이온 밤 조사가 반응성 기체로 헬륨, 수소, 산소, 결소, 암모니아, 일산화 탄소, 이산화 탄소, 사물화 탄소, 메탄, NJO 및 이들의 혼합물로 이루어진 군으로 부터 선택된 기체를 포함하는 조건하에서 이루어지는 다성분계 복합 분리막의 제조방법

# 청구항 28

제 27 항에 있어서,

상기 반응성 기체의 주입량이 0.5 내지 20 m2/분인 다성분계 복합 분리막의 제조방법.

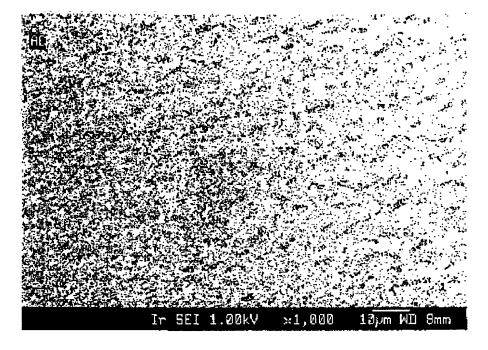
# 청구항 29

제 17 항에 있어서,

상기 다성분계 복합 분리막의 제조 공정들 중 적어도 하나 이상의 공정들이 순서에 관계없이 선 택적으로 조합되는 다성분계 복합 분리막의 제조방법.

# 丘型

<u> 501</u>



<u> 592</u>

